PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-026661

(43)Date of publication of application: 09.02.1985

· (51)Int.Cl.

C23C 14/56

G11B 5/85

H01F 41/18

(21)Application number : 58-136334

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

25.07.1983

(72)Inventor: FUJII KENICHI

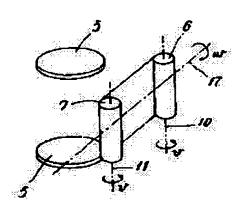
HATTORI MASUZO

(54) DEVICE FOR PRODUCING THIN FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent wrinkling and warping of a flexible film traveling between two rolls in the stage of performing sputtering onto said film by rotating both rolls around the axial centers thereof and rotating the same in the traveling direction of the film as well.

CONSTITUTION: Plasma by glow discharge is generated between a pair of targets 5 opposed to each other in a vacuum vessel to form a thin film on a flexible film traveling between a take-up roll 6 and a taken-up roll 7. The rolls 6, 7 are rotated respectively at a specified circumferential speed (v) around the axial centers 10, 11 of the rolls and are rotated at a specified angular speed (w) around the axial center 12 extending in the take-up direction of the film. The thin film is thus formed on both surfaces of the film and since no temp. difference arises between both sides of the film, the film is prevented from wrinkling and warping.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60-26661

f) Int. Cl.⁴C 23 C 14/56G 11 B 5/85

H 01 F 41/18

識別記号

庁内整理番号 7537—4K 7314—5D

7354-5E

砂公開 昭和60年(1985)2月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

69薄膜製造装置

20特

願 昭58-136334

@出

顛 昭58(1983)7月25日

@発 明 者

藤井謙一

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑩発 明 者 服部益三

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

⑭代 理 人 弁理士 森本義弘

明 和 曹

1. 発明の名称

跨膜製造装置

G

2. 特許請求の範囲

1. 相互に対向するように配設された少なくとも一対のターゲットと着膜すべき基板として被シフレキシブルフイルムの巻取りロール及び被巻取りロールとを真空容器中に備え、両ロールををでいる回りに回転させるように構成して成る薄膜の造して回転させるように構成して成る薄膜の造

8. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、巻取り可能なフレキシブルフイルムの両面あるいは片面にスパツタリングにより高速に薄膜を形成するための薄膜製造装置に関する。 従来例の構成とその問題点

近年、磁性体ターゲットでも高速スパッタリングが可能な方法として対向ターゲット式スパッタ

法が考案されている。この方法は、基板への電子 複数が少ないので、ポリエチレンフィルムなどの 耐熱性の乏しい有機フレキシブルフィルム上に 曲 性薄膜を形成する有力な手法と考えられる。

対向ターゲット式スパッタ法によりフレキシブルフィルム上に着膜して薄膜を形成するための従来の薄膜製造装置は、第1図に示すような構成になっている。すなわち、同図において、(1)は真空容器(1)に接続されてこの真空を置し、(3)は筒状の真空を変している。の真空を置している。(4)により磁化される相互に対向レルド、(5)は磁石(4)により磁化される相互に対向レイルの影のを動して、(6)はフレキシブルフィルム(8)のための被巻取りロールである。フレキシブルフィルム(8)の支持用ロールである。

以上のように構成された従来の薄膜製造装置においては、対向するターゲット(6)の間にグロー放電によるプラズマを発生させ、その際のスパッタ効果によりフレキシブルフィルム(8)上に薄膜形成を行うようになつている。そして、ロール(6)(7)(9)

特別階60-26661(2)

を各々一定の周速度で回転させておくとフレキシブルフイルム(8)上に連続薄膜を形成できるものである。

しかしながら、上記のような構成においては、フレキシブルフイルム(8)の一方の面はプラズ流で含む空間にさらされて絶えず熱エネルギーが流っしているにもかかわらず、他方の面は支持用のレル(8)という熱的に安定な媒質と接しているためで不均一な熱収が上し、結果としてフレキシブルフィルム(8)のしわやそりが発生しやすいという欠点を有していた。

発明の目的

発明の構成

本発明は、上記目的を達成するために、相互に

図示の実施例では、フレキシブルフィルム(8)の 片側のみに一対のターゲット(5)を配設してあるが、 フレキシブルフィルム(8)を挟んで両側に各々一対 のターゲット(5)の大きさ・ターゲット(5)間の距離・ ターゲット(5)と軸心はとの距離・ロール軸心(4)の 間の距離・フレキシブルフィルム(8)の幅等のパラ メータは、 得ようとする 海豚に対して 最適になる ように適宜決定できるものである。 さらに、 両口 対向するように配設された少なくとも一対のターゲットと箱膜すべき 芸板としてのフレキシブルフィルムの巻取りロール及び 被巻取りロールを真空容器中に備え、 両ロールをそれぞれのロール 軸心回りに回転させるように存取り方向に延びる軸心回りに回転させるように存成して成る薄膜製造装置を提供する。

奥施例の説明

以下、本発明の一実施例を第2図に基づいて説明する。尚、第2図において、第1図のものと同一の部材については同一の参照番号を付してある。

第2図に示す本発明の薄膜製造装置においては、第1図のような支持用ロール(®)を設けず、対向する一対のターゲット(5)からのスパッタ効果に取りフレキシブルフィルム(®)に薄膜を形成するに際して、巻取りロール(W)及び被巻取りロール(7)の両方を、それぞれのロール軸心(4)(4)回りで回転させる。すなわち、両ロ 延びる軸心(4)回りに回転させる。すなわち、両ロ

使

ール(6)(7)の軸心は回りの回転角/度wは必ずしも一定である必要はなく、時間 t に対して変化するようにw(t)としてもよいので、最適のw(t)を選ぶととができる。

発明の効果

以上述べたように、本発明に係る薄膜製造装置では、フレキシブルフィルムを連続的に供給するための一対のロールを、フィルムの巻取り方向に延びる軸心回りに回転させる構成にしているので、フィルムの両面に受ける熱エネルギーが相等しいための結果として、フィルムのしわやそりを発生することなく平坦性の優れた薄膜を形成できるという効果がある。

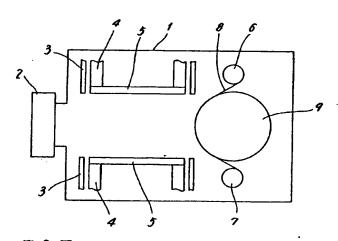
4. 図面の簡単な説明

第1図は対向ターゲット式スパッタ法を利用した従来の薄膜製造装置の概略構成を示す平面図、第2図は本発明の一実施例に係る対向ターゲット式スパッタ法を利用した薄膜製造装置の概略構成を示す斜視図である。

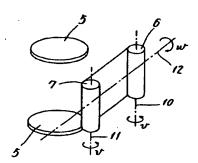
"(1)…真空容器、(5)…ターゲット、(6)…巻取りロール、(7)…被巻取りロール、(8)…フレキシブルフイルム、00 00…ロール軸心、03…巻取り方向に延びる軸心

代理人 森 本 巍 弘

第/図



第2図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
□ OTHER.	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.